## METHOD FOR SMOOTHING FLOAT GLASS SUBSTRATE

Publication number: JP9295833 (A) Publication date: 1997-11-18 Inventor(s): NOSHIRO MAKOTO SEIMI CHEM KK

Applicant(s):

Classification: C03C15/02; C03C19/00; C03C15/00; C03C19/00; (IPC1-7): C03C15/02; C03C19/00 - international:

C03C15/02 - European:

Application number: JP19960107331 19960426 Priority number(s): JP19960107331 19960426

### Abstract of JP 9295833 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the generation of flaw on a polished glass surface caused by top speck by removing fine foreign matters from the surface of a formed float glass substrate and polishing the glass substrate surface. SOLUTION: A float glass substrate produced by continuously casting a molten glass on the surface of a molten metal bath and forwarding the formed glass ribbon along the surface of the molten metal bath is smoothed by removing small foreign matters existing on the surface of the substrate and polishing the surface of the float glass substrate. The removal of the small foreign matters (top speck) can be carried out either by (1) immersing the float glass substrate in an aqueous solution of hydrofluoric acid or (2) immersing the float glass substrate in an acidic aqueous solution containing bivalent chromium ion.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

# 特開平9-295833

(43)公開日 平成9年(1997)11月18日

(51) Int.Cl.*	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
C 0 3 C 15/02 19/00			C 0 3 C	15/02 19/00	z	

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 3 頁)

(21)出願番号	特願平8-107331	(71)出願人	000108030 セイミケミカル株式会社
(22)出顧日	平成8年(1996)4月26日		神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎 3丁目 2番10号
		(72) 発明者	
			神奈川県茅ケ崎市茅ケ崎 3 丁目 2 番10号
			セイミケミカル株式会社内
		(74)代理人	弁理士 泉名 謙治

(54) 【発明の名称】 フロートガラス基板の平坦化方法

(57)【要約】

【課題】トップスペックによるガラス研磨面の傷を防止 する

【解決手段】フロート法により成板されたガラス基板の 表面に存在する微小な契約を、フッ化水素酸水溶液、又 は2 価のクロムイオンを含む酸性水溶液に浸漬して除去 した後に表面を研修する。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】溶融金属浴面上に溶融ガラスを連続的に流 してガラスリボンを形成し、とのガラスリボンを溶融金 属浴面に沿って前進させて成板されたフロートガラス基 板の表面に存在する微小な異物を除去した後、前記フロ ートガラス基板表面を研磨することを特徴とするフロー トガラス基板の平均化方法。

[請求項2] フッ化水素酸水溶液にフロートガラス基板 を浸漬することにより、前記微小な異物を除去すること を特徴とする請求項1のフロートガラス基板の平坦化方 10 を酸で溶解する(以下、方法2という)ことによって行 法。

【請求項3】2価のクロムイオンを含む酸性水溶液にフ ロートガラス基板を浸漬することにより、前記微小な異 物を除去することを特徴とする請求項1のフロートガラ ス基板の平坦化方法。

#### [発明の詳細な説明]

#### [0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、フロートガラス基 板の平坦化方法に関するものである。

#### [0002]

「従来の技術」現在ガラス基板の主要な製造方法はフロ ート法である。とれは、溶融金属浴と呼ばれる溶融金属 錫を満たした浴面上に溶融ガラスを連続的に流してガラ スリボンを形成し、とのガラスリボンを溶融金属浴面に 沿って浮かしながら前進させて成板するため、ガラスリ ボンの上面側には溶融金属浴の縄によるトップスペック が遊けられない。トップスペックとは、溶融金属浴から 蒸発した螺成分が浴上部に凝縮し、凝縮物又はこの凝縮 物が金属状態に還元されたものがガラス素地上に小粒と して落下してガラスリボンの上面に数 4~数10 4の異 30 物が生じたものである。また、溶融錫と接するガラスリ ボンの下面側にも、錫又は錫化合物からなるボトムスペ ックが発生する。

【0003】フロート法によるガラス基板を利用上必要 とされる平坦性を確保するために成板後研磨する場合、 トップスペックが研磨作業中にガラスより離脱し、研磨 剤中に混入してガラス表面を傷つけ、研磨後に表面に残 る傷は重大な欠陥となる。

#### [0004]

[発明が解決しようとする課題] 本発明は、かかるフロ 40 ートガラス基板のトップスペックによるガラス研磨面の 傷を防止したフロートガラス基板の平坦化方法を提供す るものである。

#### [0005]

[課題を解決するための手段] 即ち、本発明は、溶融金 屋浴面上に溶融ガラスを連続的に流してガラスリボンを 形成し、このガラスリボンを溶融金属浴面に沿って前進 させて成板されたフロートガラス基板の表面に存在する 微小な異物を除去した後に該表面を研磨することを特徴

# である。

#### [00006]

【発明の実施の形態】本発明は、トップスペックを予め 除去した後、研磨を行うことにより、研磨面の傷を防止 するものである。トップスペックの除去は、フッ化水素 酸水溶液にフロートガラス基板を浸清してトップスペッ ク周辺のガラスを溶解する(以下、方法1という)、又 は、Cr1・を含む酸性水溶液にフロートガラス基板を浸 漬し、Cr<sup>2+</sup>の還元反応を利用してトップスペック自体

【0007】方法1では、反応物を溶解するためフッ化。 水素酸に酸を添加するのが好ましく、たとえば、3 w t %HFと3wt%H, SO, の1対1水溶液が挙げられ る。との場合、液温28℃でガラスの溶解速度は毎分約 5 µであり、15分程度ですべてのトップスペック を除去できる。

[0008] 方法2では、Cr2+の空気酸化を防ぐた め、イオン交換膜を用いた電解反応によって安定化を図 20 るのがよい。具体的には、希塩酸中で形成されたCr20 /Cr3・レドックス系を含む槽とレドックス系を含まな い希硫酸溶液の槽を陽イオン交換膜で分離し、両槽に炭 素電極を挿入し、レドックス槽電極に負、希硫酸槽の電 極に正の電荷を印加した電解槽を用いて、レドックス系 槽にトップスペック (およびボトムスペック) を有する フロートガラス基板を浸漬し、トップスペック等を除去 するのが好ましい。

#### [00009] 【実施例】

[実施例1] 3wt%HFと3wt%H2SO4の1対 1 水溶液に、1. 1 m m 厚、30 c m 角のフロートガラ ス基板を浸漬した。液温は28℃、浸漬時間は15分と した。このガラス30枚をオスカー型研磨機で1分間研 磨した。研磨剤は酸化セリウムで循環使用した。研磨表 面の傷は、高輝度光源下で目視により検査し、ガラス面 上に傷が認められない場合をA、1個認められる場合を B. 2個以上認められる場合をCとすると、浸清処理せ ずに研磨したものでは、Aが8枚、Bが10枚、Cが1 2枚であったのにたいし、上記浸漬処理をした後に研磨 したものでは、Aが19枚、Bが6枚、Cが5枚であっ た。とのことから、上記浸漬処理により明らかに表面の 傷が減少した。

[0010] [実施例2] 金属クロムを6 N塩酸と6 N 硫酸の1対1水溶液に5wt%の濃度で溶解し、1、1 mm厚、30cm角のフロートガラス基板を浸漬した。 液温は50°C. 浸清時間は3分とした。このガラス30 枚をオスカー型研磨機で1分間研磨した。研磨剤は酸化 セリウムで循環使用した。研磨表面の傷は、高輝度光源 下で目視により検査し、ガラス面上に傷が認められない とするフロートガラス基板の平坦化方法を提供するもの 50 場合をA. 1個認められる場合をB. 2個以上認められ る場合をCとすると、浸漬処理せずに研磨したものでは、Aが8枚、Bが10枚、Cが12枚であったのに対し、上記浸漬処理をした後に研磨したものでは、Aが18枚、Bが6枚、Cが6枚であった。このことから、上記浸漬処理により明らかに表面の僅が減少した。

[0011]

【発明の効果】本発明によれば、トップスペックが予め 除去されているため、研磨剤中への混入がなく、トップ スペックによってガラス表面が傷つくことがない。